

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)

【公開番号】特開 2004-177947 (P2004-177947A)  
 【公開日】平成 16 年 6 月 24 日 (2004.6.24)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-024  
 【出願番号】特願 2003-379504 (P2003-379504)  
 【国際特許分類】

**G 0 2 B 6/42 (2006.01)**

【 F I 】

G 0 2 B 6/42

【手続補正書】  
 【提出日】平成 17 年 12 月 5 日 (2005.12.5)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 4 1  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 4 1 】

まず、コントローラ 5 が行う位置決め処理の原理について説明する。図 4 A ~ 図 4 C は、L D からの光の入射端面 3 a における入射位置と、L D からの光が各入射位置にあるときの X 方向の光強度分布を示した図である。各図に示す入射端面 3 a は図面左側が X ( - ) 方向、右側が X ( + ) 方向である。図 4 A は、L D からの光がコア 3 c よりも X ( - ) 方向に入射している状態と該状態における L D からの光の光強度分布を示す。図 4 B は、L D からの光がコア 3 c よりも X ( + ) 方向に入射している状態と該状態における L D からの光の光強度分布を示す。図 4 C は、L D からの光の入射位置がコア 3 c と略一致する状態と該状態における L D からの光の光強度分布を示す。